

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成24年3月8日 (2012.3.8)

【公表番号】特表2011-511313(P2011-511313A)

【公表日】平成23年4月7日 (2011.4.7)

【年通号数】公開・登録公報2011-014

【出願番号】特願2010-544794(P2010-544794)

【国際特許分類】

G 0 2 B 5/20 (2006.01)

G 0 2 B 27/02 (2006.01)

G 0 2 F 1/1335 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 5/20 1 0 1

G 0 2 B 27/02 Z

G 0 2 F 1/1335 5 0 5

【手続補正書】

【提出日】平成23年1月20日 (2011.1.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

媒体上に画像を形成する方法であって：

走査方向に沿って前記媒体上を走査しながら前記画像を形成するように放射線ビームを放射するよう画像化ヘッドを制御するステップであり、前記画像は、前記走査方向に対して或る傾斜角だけ傾斜した方向に延在するエッジ部を含む造形部を有し、各放射線ビームは、該放射線ビームによって前記媒体上に形成される画素のサイズを変化させるように制御可能である、ステップ；

前記媒体上に形成されるべき複数の画素の各画素が有する少なくとも 1 つのサイズを決定するステップであり、各画素は、第 1 の方向に沿った第 1 のサイズと、前記第 1 の方向と交差する第 2 の方向に沿った第 2 のサイズとを有し、前記第 2 のサイズは、前記第 1 のサイズと異なり、且つ少なくとも前記傾斜角と前記第 1 のサイズとに基づいて決定される、ステップ；及び

前記造形部の前記エッジ部に沿って前記複数の画素の階段配置を形成するために一群の放射線ビームを放射するよう前記画像化ヘッドを制御するステップであり、前記第 1 のサイズと前記決定された第 2 のサイズとで前記階段配置内の各画素を形成するよう、前記一群の放射線ビームの各放射線ビームが制御される、ステップ；

を有する方法。

【請求項 2】

前記第 2 の方向は前記 1 の方向に実質的に垂直である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記第 2 の方向は前記走査方向に実質的に平行である、請求項 1 に記載の方法。